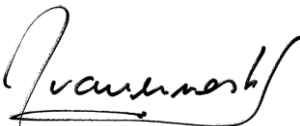


	Espacio reservado para el adhesivo de radicación
---	--

DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
Procedimiento acelerado de exámenes de patente (PPH)

1	NÚMERO DE SOLICITUD ANTE LA SIC NC2019/0014448		
2	GLOBAL - PPH ☒ PAÍS Australia	3	PCT – PPH ☐ PAÍS
4	PROSUR ☐ PAÍS	5	Alianza del Pacifico (AdP) ☐ PAÍS
6	OFICINA DE PRIMERA PRESENTACIÓN (OPP) ☐	7	OFICINA DE EXAMEN ANTERIOR (OEA) ☐
8	NÚMERO DE SOLICITUD O PUBLICACIÓN DE LA SOLICITUD (OPP) ☐ NÚMERO DE SOLICITUD EN OFICINA DE EXAMEN ANTERIOR (OEA): ☐ NÚMERO DE SOLICITUD PCT: PCT/US2017/068397 ☒		1.
9	☐ REPRESENTANTE LEGAL ☒ APODERADO		
APELLIDOS Cuesta Quintero		NOMBRES Juan Carlos	IDENTIFICACIÓN C.C 79.339.809 T.P. 43.273
DIRECCIÓN Calle 72 No. 10-07 Oficina 603		No. TELÉFONO 2113097	
CIUDAD Bogotá D.C.		CORREO ELECTRÓNICO juancuesta@cuestalawyer.com	
PAÍS Colombia		No. RADICACIÓN O PROTOCOLO DE PODER GENERAL NC2020/0004832	
10	CONDICIONES PARA ACCEDER A ESTE PROCESO: Trabajo Oficina de Patentes de Australia		
10.1. DATOS DE PRIORIDAD ☐ SI ☒ NO			
(33) PAÍS DE ORIGEN		CÓDIGO PAÍS	(31) NÚMERO
1.			(32) FECHA (AAAA/MM/DD)
2.			
10.2. DATOS SOLICITUD INTERNACIONAL PCT ☐ SI ☐ NO			
Solicitud Internacional No.		PCT/US2017/068397	Fecha 26/12/2017
Publicación Internacional No.		WO/2019/132857	Fecha 04/07/2019
*El solicitante presenta una copia de la(s) reivindicación(es) patentable(s) u otorgable(s) de la solicitud de la Oficina de Primera Presentación que profirió el examen de patentabilidad, junto con una traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
*El solicitante presenta los resultados de búsqueda de la Oficina de Examen Anterior, junto con una traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
REQUISITOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE EXÁMENES DE PATENTABILIDAD EFECTUADOS A SOLICITUDES EXTRANJERAS			
Para que la Superintendencia de Industria y Comercio pueda reconocer los resultados de exámenes de patentabilidad producidos por otras Oficinas de Propiedad Industrial se debe cumplir con las siguientes condiciones:			
(a) Al momento de solicitar el examen de patentabilidad, si el solicitante pide que se reconozcan exámenes de patentabilidad de otras oficinas extranjeras, deberá aportar junto con el pago de la tasa correspondiente, los siguientes anexos:			
(i) Copia de las resoluciones, fallos o decisiones que han sido relevantes para la determinación de la patentabilidad de la(s) solicitud(es) en la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad que contienen reivindicaciones patentables u otorgables que son la base de la petición, y si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
(ii) Copia de todas las reivindicaciones determinadas como patentables u otorgables en la Oficina que profirió el examen de patentabilidad y, si es del caso, su traducción al castellano. ☒ SI ☐ NO			
(iii) Copia de los antecedentes, información o documentos citados por el examinador de la Oficina de Primera Presentación del examen de patentabilidad, en las resoluciones, fallos o decisiones correspondientes, incluyendo la literatura no patente. Los documentos de patente deberán presentarse siempre y cuando no estén disponibles para la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el simple acceso a bases de datos gratuitas. ☒ SI ☐ NO			
(iv) Una tabla de correspondencias de las reivindicaciones que han sido determinadas como patentables u otorgables en la solicitud de la Oficina que haya proferido el examen de patentabilidad. ☒ SI ☐ NO			
11	FIRMA DEL SOLICITANTE, DEL APODERADO O DEL REPRESENTANTE LEGAL Junto a cada firma, indicar el nombre del firmante y su calidad (si tal calidad no es obvia al leer el petitorio)		
			

10 (iv)	TABLA DE CORRESPONDENCIA DE REIVINDICACIONES		
Reivindicaciones en la solicitud en Colombia		Reivindicaciones otorgables en la solicitud australiana	Comentarios que explican la correspondencia
1. Un sistema que comprende: una estructura de sensor de imagen que comprende: una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, una pila de dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen, una almohadilla de unión dispuesta en la pila de dispositivos, una pila de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión, una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa superior de la pila de pasivación, una vía a través de silicio (TSV) en contacto eléctrico con la almohadilla de unión, extendiéndose la TSV a través del sustrato base, y una capa de redistribución (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas; en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la almohadilla de unión.		1. Un sistema que comprende: una estructura de sensor de imagen que comprende: una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, una pila de dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen, una almohadilla de unión dispuesta en la pila de dispositivos, una pila de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión, una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa superior de la pila de pasivación, una vía a través de silicio (TSV) en contacto eléctrico con la almohadilla de unión, extendiéndose la TSV a través del sustrato base, y una capa de redistribución (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas; en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la almohadilla de unión.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
2. El sistema de la reivindicación 1, que comprende: una primera (1ª) capa de protección ambiental dispuesta sobre una 1ª parte de la RDL; estructuras de soporte mecánico dispuestas sobre la 1ª capa de protección ambiental; y cables unidos en contacto eléctrico con una segunda (2ª) parte de la RDL.		2. El sistema de la reivindicación 1, que comprende: una primera (1ª) capa de protección ambiental dispuesta sobre una 1ª parte de la RDL; estructuras de soporte mecánico dispuestas sobre la 1ª capa de protección ambiental; y cables unidos en contacto eléctrico con una segunda (2ª) parte de la RDL.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
3. El sistema de la reivindicación 2, que comprende: una 2ª capa de protección ambiental dispuesta sobre la 2ª parte de la RDL; en donde la 1ª y la 2ª capas de protección ambiental cubren toda la RDL.		3. El sistema de la reivindicación 2, que comprende: una 2ª capa de protección ambiental dispuesta sobre la 2ª parte de la RDL; en donde la 1ª y la 2ª capas de protección ambiental cubren toda la RDL.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
4. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la almohadilla de unión es una pluralidad de almohadillas de unión sobre las cuales está dispuesto el canal de flujo.		4. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en donde la almohadilla de unión es una pluralidad de almohadillas de unión sobre las cuales está dispuesto el canal de flujo.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624

5. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la pila de pasivación comprende: una 1ª capa de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; y una 1ª capa de protección química dispuesta sobre la 1ª capa de pasivación.	5. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en donde la pila de pasivación comprende: una 1ª capa de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; y una 1ª capa de protección química dispuesta sobre la 1ª capa de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
6. El sistema de la reivindicación 5, en donde la pila de pasivación comprende: una 2ª capa de pasivación dispuesta sobre la 1ª capa de protección química; y una 2ª capa de protección química dispuesta sobre la 2ª capa de pasivación.	6. El sistema de la reivindicación 5, en donde la pila de pasivación comprende: una 2ª capa de pasivación dispuesta sobre la 1ª capa de protección química; y una 2ª capa de protección química dispuesta sobre la 2ª capa de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
7. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende: una matriz de detectores de luz dispuesta en la capa de imagen; y una matriz de guías de luz dispuesta en la pila de dispositivos, estando asociada cada guía de luz con al menos un detector de luz de la matriz de detectores de luz.	7. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, que comprende: una matriz de detectores de luz dispuesta en la capa de imagen; y una matriz de guías de luz dispuesta en la pila de dispositivos, estando asociada cada guía de luz con al menos un detector de luz de la matriz de detectores de luz.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
8. El sistema de la reivindicación 7, en donde la pila de pasivación comprende una superficie inferior en contacto directo con una superficie superior de las guías de luz.	8. El sistema de la reivindicación 7, en donde la pila de pasivación comprende una superficie inferior en contacto directo con una superficie superior de las guías de luz.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
9. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde la celda de flujo comprende: una tapa de celda de flujo fijada a las paredes laterales de la celda de flujo, estando unidas las paredes laterales de la celda de flujo a la capa superior de la pila de pasivación; en donde el canal de la celda de flujo está formado por la tapa de la celda de flujo, las paredes laterales de la celda de flujo y la capa superior de la pila de pasivación.	9. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, en donde la celda de flujo comprende: una tapa de celda de flujo fijada a las paredes laterales de la celda de flujo, estando unidas las paredes laterales de la celda de flujo a la capa superior de la pila de pasivación; en donde el canal de la celda de flujo está formado por la tapa de la celda de flujo, las paredes laterales de la celda de flujo y la capa superior de la pila de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
10. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende: una capa de protección contra la luz, dispuesta entre la pila de dispositivos y la pila de pasivación; en donde la almohadilla de unión se extiende a través de la capa de protección contra la luz.	10. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, que comprende: una capa de protección contra la luz, dispuesta entre la pila de dispositivos y la pila de pasivación; en donde la almohadilla de unión se extiende a través de la capa de protección contra la luz.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624

11. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde una superficie superior de la almohadilla de unión está dispuesta debajo de una superficie inferior de la pila de pasivación.	11. El sistema de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en donde una superficie superior de la almohadilla de unión está dispuesta debajo de una superficie inferior de la pila de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
12. Un sistema que comprende: una estructura de sensor de imagen que comprende: una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, comprendiendo la capa de imagen una matriz de detectores de luz dispuesta en su interior, una pila de dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen, una pluralidad de almohadillas de unión dispuesta en la pila de dispositivos, una matriz de guías de luz dispuesta en la pila de dispositivos, una pila de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la pluralidad de almohadillas de unión, una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa superior de la pila de pasivación, una vía a través de silicio (TSV) en contacto eléctrico con las almohadillas de unión de la pluralidad de almohadillas de unión, extendiéndose la TSV a través del sustrato base, y una capa de redistribución (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas; en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la pluralidad de almohadillas de unión.	12. Un sistema que comprende: una estructura de sensor de imagen que comprende: una capa de imagen dispuesta sobre un sustrato base, comprendiendo la capa de imagen una matriz de detectores de luz dispuesta en su interior, una pila de dispositivos dispuesta sobre la capa de imagen, una pluralidad de almohadillas de unión dispuesta en la pila de dispositivos, una matriz de guías de luz dispuesta en la pila de dispositivos, una pila de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la pluralidad de almohadillas de unión, una matriz de nanopocillos dispuesta en una capa superior de la pila de pasivación, una vía a través de silicio (TSV) en contacto eléctrico con las almohadillas de unión de la pluralidad de almohadillas de unión, extendiéndose la TSV a través del sustrato base, y una capa de redistribución (RDL) dispuesta sobre una superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y una celda de flujo dispuesta sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas; en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la pluralidad de almohadillas de unión.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
13. El sistema de la reivindicación 12, que comprende: una 1ª capa de protección ambiental dispuesta sobre una 1ª parte de la RDL; estando las estructuras de soporte mecánico dispuestas sobre la 1ª capa de protección ambiental; cables unidos en contacto eléctrico a una 2ª parte de la RDL; y una 2ª capa de protección ambiental dispuesta sobre la 2ª parte de la RDL; en donde la 1ª y la 2ª capas de protección ambiental cubren toda la RDL.	13. El sistema de la reivindicación 12, que comprende: una 1ª capa de protección ambiental dispuesta sobre una 1ª parte de la RDL; estando las estructuras de soporte mecánico dispuestas sobre la 1ª capa de protección ambiental; cables unidos en contacto eléctrico a una 2ª parte de la RDL; y una 2ª capa de protección ambiental dispuesta sobre la 2ª parte de la RDL; en donde la 1ª y la 2ª capas de protección ambiental cubren toda la RDL.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624

14.	El sistema de la reivindicación 12 o 13, en donde la pila de pasivación comprende: una 1ª capa de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la pluralidad de almohadillas de unión; y una 1ª capa de protección química dispuesta sobre la 1ª capa de pasivación.	14.	El sistema de la reivindicación 12 o 13, en donde la pila de pasivación comprende: una 1ª capa de pasivación dispuesta sobre la pila de dispositivos y la pluralidad de almohadillas de unión; y una 1ª capa de protección química dispuesta sobre la 1ª capa de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
15.	El sistema de la reivindicación 14, en donde la pila de pasivación comprende: una 2ª capa de pasivación dispuesta sobre la 1ª capa de protección química; y una 2ª capa de protección química dispuesta sobre la 2ª capa de pasivación.	15.	El sistema de la reivindicación 14, en donde la pila de pasivación comprende: una 2ª capa de pasivación dispuesta sobre la 1ª capa de protección química; y una 2ª capa de protección química dispuesta sobre la 2ª capa de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
16.	Un método que comprende: disponer una pila de dispositivos y una capa de imagen sobre una capa de sustrato base, respectivamente; disponer una almohadilla de unión en la pila de dispositivos; disponer al menos una parte de una pila de pasivación sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; formar una matriz de nanopocillos en una capa superior de la pila de pasivación; grabar una TSV a través de una superficie inferior del sustrato base, extendiéndose la TSV hacia la almohadilla de unión; enchapar la TSV para que haga contacto eléctrico con la almohadilla de unión; disponer una RDL en la superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y disponer una celda de flujo sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas, en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la almohadilla de unión.	16.	Un método que comprende: disponer una pila de dispositivos y una capa de imagen sobre una capa de sustrato base, respectivamente; disponer una almohadilla de unión en la pila de dispositivos; disponer al menos una parte de una pila de pasivación sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; formar una matriz de nanopocillos en una capa superior de la pila de pasivación; grabar una TSV a través de una superficie inferior del sustrato base, extendiéndose la TSV hacia la almohadilla de unión; enchapar la TSV para que haga contacto eléctrico con la almohadilla de unión; disponer una RDL en la superficie inferior del sustrato base, estando la RDL en contacto eléctrico con la TSV; y disponer una celda de flujo sobre la capa superior de la pila de pasivación para formar un canal de flujo entre ellas, en donde el canal de flujo está dispuesto sobre la matriz de nanopocillos y la almohadilla de unión.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
17.	El método de la reivindicación 16, que comprende: disponer una 1ª capa de protección ambiental sobre una 1ª parte de la RDL; unir las estructuras de soporte mecánico sobre la 1ª capa de protección ambiental; y	17.	El método de la reivindicación 16, que comprende: disponer una 1ª capa de protección ambiental sobre una 1ª parte de la RDL;	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624

unir el cable a una 2ª parte de la RDL, estando el cable unido en contacto eléctrico con la RDL.	unir las estructuras de soporte mecánico sobre la 1ª capa de protección ambiental; y unir el cable a una 2ª parte de la RDL, estando el cable unido en contacto eléctrico con la RDL.	
18. El método de la reivindicación 17, que comprende: disponer una 2ª capa de protección ambiental sobre la 2ª parte de la RDL; y cubrir la RDL completamente con la 1ª y 2ª capas de protección ambiental.	18. El método de la reivindicación 17, que comprende: disponer una 2ª capa de protección ambiental sobre la 2ª parte de la RDL; y cubrir la RDL completamente con la 1ª y 2ª capas de protección ambiental.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
19. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en donde disponer al menos una parte de una pila de pasivación comprende: disponer una 1ª capa de pasivación sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; disponer una 1ª capa de protección química sobre la 1ª capa de pasivación; y disponer una 2ª capa de pasivación sobre la 1ª capa de protección química.	19. El método de una cualquiera de las reivindicaciones 16 a 18, en donde disponer al menos una parte de una pila de pasivación comprende: disponer una 1ª capa de pasivación sobre la pila de dispositivos y la almohadilla de unión; disponer una 1ª capa de protección química sobre la 1ª capa de pasivación; y disponer una 2ª capa de pasivación sobre la 1ª capa de protección química.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624
20. El método de la reivindicación 19, en donde la formación de una matriz de nanopocillos comprende: grabar la matriz de nanopocillos en la 2ª capa de pasivación; y disponer una 2ª capa de protección química sobre la 2ª capa de pasivación.	20. El método de la reivindicación 19, en donde la formación de una matriz de nanopocillos comprende: grabar la matriz de nanopocillos en la 2ª capa de pasivación; y disponer una 2ª capa de protección química sobre la 2ª capa de pasivación.	Reivindicación igual a la presentada en la solicitud australiana 2017444624

